

LC Passivation Solution (不動態化溶液) 使用方法

Cat.No. 1021-10176 (Restek P/N 32475)

グリホサートに代表されるリン酸基を持つ化合物は、キレート化または金属イオンと相互作用することが知られており、LCシステムのステンレス配管やLCカラムハードウェアに吸着する性質があります。

本製品は、1760 μ g/mLの濃度のメチレンジホスホン酸がメタノール/水(50:50)に溶解されています。LCシステムにサンプル溶液としてそのままインジェクションすることによって、LCシステム配管内の金属部分をマスキングすることができるため、リン酸系化合物全般において、簡単に吸着による影響を抑制することができます。

LCシステムの不動態化手順

1. LCカラムとガードカラムを取り外し、ユニオンで配管を接続します。
2. 検出器から配管を外して廃液ボトル等につなぎます。
3. 移動相の流量を0.4 mL / minに、移動相の組成を、「水：アセトニトリル=50:50」もしくは、「水：メタノール=50:50」に設定します。
4. Passivation Solutionをフルループで10回注入します。
(注意：オンカラム大量注入は、データ品質に悪影響を及ぼす可能性があります。)
5. 移動相をさらに1分間流して、Passivation SolutionをLCの流路から排出します。
6. 移動相の送液を停止し、LCカラムとガードカラムを取り付けます。
7. 残りの溶液は、製品ラベルの指示に従って保管します。

LCカラムの不動態化手順

1. LCカラムとガードカラムを取り付けます。
2. 検出器から配管を外して廃液ボトル等につなぎます。
3. Passivation Solution 2 μ Lを5回注入します。移動相条件は通常の実験条件を使用します。
4. 残りの溶液は、製品ラベルの指示に従って保管します。

注) 本使用法は、製造者である米国Restek Corporationの取扱説明書をジーエルサイエンスで和訳したものです。内容は英語原文が優先されます。原文は以下のURLからご参照ください。

<https://www.restek.com/pdfs/480-01-001.pdf>

製造者：Restek Corporation

販売者：ジーエルサイエンス株式会社 〒163-1130 東京都港区西新宿6-22-1

TEL：03-5323-6611

